



即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛 穆銳農)

Open Sky Communications

電話: +1-415-519-3915

電郵: dmoreno@openskypr.com

EUV TECH 和 IBM 加入 EBEAM INITIATIVE

加利福尼亞州聖約瑟，2023 年 2 月 28 日—eBeam Initiative 一個致力於推動和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體，今天宣佈有兩家新的公司成為其組織成員：EUV Tech 是卓越的 EUV 測量設備領導者；IBM 則是先進製造技術的行業的領導者和先驅。這兩家新成員將於今天晚些時候在聖約瑟與 SPIE 先進微影和圖形化會議（Advanced Lithography + Patterning Conference）一起舉行的第 15 屆 eBeam Initiative 會議上獲得正式的認可。

eBeam Initiative 並宣佈發表了其第三份年度深度學習（DL）調查報告，涵蓋了其成員公司在光罩到晶圓製造流程中使用 DL 的產品和應用。13 家成員公司的 DL 應用完整列表可在 www.ebeam.org 上找到。

“我對 EUV Tech 和 IBM 加入 eBeam Initiative 感到非常的興奮。他們的貢獻將為 eBeam Initiative 的 50 多家成員公司增添動力，這些公司正在共同努力教育和促進光罩業對半導體產業和技術的貢獻，” eBeam Initiative 的管理公司 D2S 的首席執行官藤村先生表示。

藤村補充道：“深度學習為改善半導體設計和製造提供了顯著的益處。幾個月前公佈的第 11 屆 eBeam Initiative 傑出人物調查結果表示，行業仍然對深度學習成為光罩製造的競爭優勢抱有很高期望，儘管只有 33% 的參與者認為這將在 2023 年之前實現。然而，根據我目前看到的情況，雖然一些公司仍不確定如何使用深度學習來幫助他們的業務，但其他公司似乎將深度學習視為一項基礎技術，以多種方式加以應用中。例如，從我們最新列表上的成員的應用中可以明顯看出，他們將深度學習的重點放在啟用曲線光罩、預測維護和提高光罩製造和微影的產出量上。”

關於 The eBeam Initiative

The eBeam Initiative 是一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。The eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多積體電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。會員公司涵蓋整個半導體生態系統，包括：aBeam Technologies、Advantest、Alchip Technologies、AMD、AMTC、Applied Materials、Artwork Conversion、Aselta Nanographics、ASML、Cadence Design Systems、Canon、CEA-Leti、D2S、Dai Nippon Printing、EQUIcon Software GmbH Jena、ESOL、EUV Tech、Fractilia、Fraunhofer IPMS、Fujitsu Semiconductor Limited、GenISys GmbH、GlobalFoundries (GF)、Grenon Consulting、Hitachi High-Tech Corporation、HJL Lithography、HOLON CO.、LTD、HOYA Corporation、IBM、imec、IMS CHIPS、IMS Nanofabrication AG、JEOL、KIOXIA、KLA、Micron Technology、Multibeam Corporation、NCS、NuFlare Technology、Petersen Advanced Lithography、Photronics、QY Mask、Samsung Electronics、Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC)、Siemens EDA、STMicroelectronics、Synopsys、TASMIT、Tokyo Electron Ltd. (TEL)、TOOL Corporation、Toppan Photomask Corporation、UBC Microelectronics、Vistec Electron Beam GmbH 和 ZEISS。會員資格向整個電子行業的所有公司和機構開放。細節請查看 www.ebeam.org。